PAT-NO: JP411191216A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11191216 A

TITLE: MAGNETIC DISK AND SUBSTRATE THEREFOR

PUBN-DATE: July 13, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY TANAKA, HIDEAKI N/A GOMI, KENICHI N/A SAWAHATA, SHOICHI N/A KONDOU, MAKI N/A **OURA, MASAKI** N/A MIYAKE, YOSHIHIKO N/A KATO, YOSHIKI N/A OKUWAKI, TOYOJI N/A OKAMOTO, NORIAKI N/A NAKAGAWA, YOSHIO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY HITACHI LTD N/A

APPL-NO: JP10296405

APPL-DATE: October 19, 1998

INT-CL (IPC): G11B005/82, G11B005/72

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain floating stability of a magnetic head over a long period by arranging a lot of projecting parts having about a constant height on a disk surface to be helical centering the center of the disk, and making the deviated amount in the radial direction between those projecting parts, which are helically arranged and successively adjacent to each other, to the radial width of the projecting part or less.

SOLUTION: Linear or pit-formed projecting parts 7, consisting of parts of circular arcs of concentric circles or helical circles centering the center of rotation of a magnetic disk 14, are arranged regularly. A part of non-projected part is arranged so as to be smoothly successive from the internal circumference to the external circumference of the magnetic disk 14 within a moving area of a magnetic head. Thus, when the magnetic disk 14 is rotated by putting a slider on the magnetic disk 14, the projecting parts 7 are faced to the whole surface of the slider while they are successively slipping off to the side of the external circumference, so dusts adhered to the slider can be removed therefrom and can further be removed off the side of the external circumference through the non-projecting parts 7 by a centrifugal force.

COPYRIGHT: (C)1999.JPO

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-191216

(43)公開日 平成11年(1999)7月13日

(51) IntCL⁶

識別記号

ΡI

G11B 5/82 5/72 G11B 5/82 5/72

審査請求 有 請求項の数4 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

特局平10-296405

(62)分割の表示

特顧平9-286496の分割

(22)出顧日

平成2年(1990)3月2日

(71)出顧人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 田中 秀明

茨城県日立市久越町4026番地 株式会社日

立製作所日立研究所内

(72)発明者 五味 憲一

茨城県日立市久越町4026番地 株式会社日

立製作所日立研究所内

(72)発明者 沢畠 昇一

茨城県日立市久越町4026番地 株式会社日

図 12

立製作所日立研究所内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

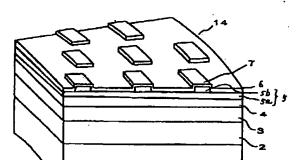
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気ディスクおよび磁気ディスク用基板

(57)【要約】

【課題】磁気ヘッドとの摩擦力や吸着力が低く、低浮上量においても磁気ヘッドの浮上安定性を保証し、長期に 亘って特性劣化の小さく、且つ耐食性を有する磁気記録 媒体を再現性良く提供する。

【解決手段】基板上に磁性層と保護層を有する磁気ディスクにおいて、保護層を、前記磁性層を覆う第一保護層と該第一保護層上に設けられた第二保護層から構成し、第二保護層により多数の凸部を形成し、第一保護層により耐食性を得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に磁性層と保護層を有する磁気ディスクにおいて、前記磁気ディスクの表面の少なくとも一部領域に該表面より突出した多数の凸部を有し、該凸部の高さはほぼ一定の高さを有し、該凸部は前記磁気ディスクの中心に対してらせん状に配置され、該らせん状に配置された凸部の連続して隣接する凸部間の半径方向のずれ量が、該凸部の半径方向の幅以下であることを特徴とする磁気ディスク。

【請求項2】非磁性円板よりなる磁気ディスク用基板に 10 おいて、前記基板の表面の少なくとも一部領域に該表面より突出した多数の凸部を有し、該凸部の高さはほぼ一定の高さを有し、該凸部は前記基板の中心に対してらせん状に配置され、該らせん状に配置された凸部の連続して隣接する凸部間の半径方向のずれ量が、該凸部の半径方向の幅以下であることを特徴とする磁気ディスク用基板。

【請求項3】基板上に磁性層と保護層を有する磁気ディスクにおいて、前記磁気ディスクの表面の少なくとも一部領域に該表面の表面粗さより大きい高さで該表面より突出した多数の凸部を有し、該凸部の高さは、5mu以上40mu以下、かつその平均高さに対して30%以内の分布で、ほぼ一定の高さを有し、該凸部は前記磁気ディスクの中心に対してらせん状に配置され、該らせん状に配置された凸部の連続して隣接する凸部間の半径方向のずれ量が、該凸部の半径方向の幅以下であることを特徴とする磁気ディスク。

【請求項4】非磁性円板よりなる磁気ディスク用基板において、前記基板の表面の少なくとも一部領域に該表面より突出した多数の凸部を有し、該凸部の高さは、5nm以上40nm以下、かつその平均高さに対して30%以内の分布で、ほぼ一定の高さを有し、該凸部は前記基板の中心に対してらせん状に配置され、該らせん状に配置された凸部の連続して隣接する凸部間の半径方向のずれ量が、該凸部の半径方向の幅以下であることを特徴とする磁気ディスク用基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は磁気ディスク装置及 びそれに用いられる磁気記録媒体と磁気記録媒体の製造 40 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータシステムの外部記憶 装置としての磁気ディスク装置の重要度は益々高まり、 その記録密度は年々著しい向上が図られている。

【0003】磁気ディスク装置の記録密度を向上させるためには、記録再生時の磁気ヘッドの浮上量を小さくするのが良く、その際の磁気ヘッドの浮上安定性を確保するために、磁気記録媒体の表面はできるだけ平坦であることが要求される。

【0004】ところで、磁気ディスク装置の起動時及び停止時において磁気ヘッドと磁気記録媒体の間に生ずる摩擦力は、両者の摩耗を引き起こし、書き込み特性或いは読み出し特性等の特性劣化の原因となる。さらに、磁気記録媒体が静止している状態で磁気ヘッドと磁気記録媒体の間に水分等が介在すると、両者が強固に吸着し、この状態で起動すると磁気ヘッドと磁気記録媒体の間に大きな力が生じ、磁気ヘッドや磁気記録媒体の間に大きな力が生じ、磁気ヘッドや磁気記録媒体の損傷を招く恐れがある。この様な摩擦力や吸着力は、磁気記録媒体の表面が平坦であるほど大きくなる傾向があり、前記した記録密度の向上に伴う磁気ヘッドの浮上安定性に対する要求と相反する。

【0005】このような摩擦力や吸着力を低減するため に、磁気記録媒体の表面に微小凹凸を形成することが知 られている。

【0006】一例として、特開平1-134720号公報には、磁気記録媒体の表面に島状に突起を設けることが示されている。

【0007】特開平1-122028号公報には、磁気記録媒体の磁性層表面に金属アルコキシド溶液を塗布し、急速加熱して磁性層表面に凹凸を有する保護層を形成することが示されている。

【0008】特開昭57-20925号公報には、磁性層又は 保護層の表面に直径が0.03~0.1mm、高さが約 0.05μmの円柱状の突起部を設けることが示されて いる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、いずれも磁気記録媒体に対する磁気へッドの浮上量を小さく 30 すること、およびその場合に磁気記録媒体に磁気へッドを支持用スライダーが吸着するのを防止することを狙っている。

【0010】磁気ヘッドの浮上安定性を長期にわたって 持続することについては、配慮していない。

【0011】本発明の目的は、磁気ヘッドの浮上安定性を持続できるようにした磁気記録媒体を提供することにある。さらに、磁気記録媒体の耐食性を向上させることにある。

【0012】本発明の他の目的は、上記目的を達成する 磁気記録媒体を備えた磁気ディスク装置を提供すること にある。

【0013】本発明の更に他の目的は、磁気ヘッドの浮上量を0.2 μm以下にでき、なお且つ浮上安定性を長期にわたって持続することができる磁気ディスク装置、およびそのための磁気記録媒体を提供することにある。【0014】

【課題を解決するための手段】本発明の磁気ディスク装置は、本質的には、基板上に磁性層と表面保護層を有する少なくとも一枚の磁気ディスク、回転中の前記磁気ディスクと微小間隙をもって対向し、スライダーによって

10

支持されている磁気ヘッド、前記磁気ディスクを回転す る回転手段、および前記磁気ヘッドを前記磁気ディスク 上の所定の位置に移動し位置決めする磁気ヘッド位置決 め手段、を具備する磁気ディスク装置において、前記磁 気ディスクの表面に下記(イ)と(ロ)を具備する多数 の表面平坦な凸部を有することを特徴とする。

【0015】(イ) 該磁気ディスクの同一円周上および 同一半径上で凸部が分断されており該凸部間に凹部を有 し、該磁気ディスクの最も近接している該凸部間の間隔 が0.2~50μmである。

【0016】(ロ) 該磁気ディスク上の任意の位置に前 記スライダーを用いて該磁気ディスクを一回転したとき に該スライダーの全面に前記凸部が接触するように該凸 部が配置されている。

【0017】本発明は、磁気記録媒体の表面に表面平坦 な凸部を多数備えると共に、該凸部に前記(イ)、

(ロ)の要件を具備させることによって、磁気ヘッドの 浮上量を小さくし且つ浮上安定性を持続できるという事 実の究明に基づいている。

【0018】前記(ロ)の要件を備えることによって、 磁気ヘッドおよびスライダーに付着する塵埃を凸部によ ってかき落すことができる。

【0019】前記(イ)の要件を備えることによって、 磁気ヘッドおよびスライダーからかき落とした塵埃を、 磁気記録媒体表面の凸部間の凹みを利用してスライダー 外部へ排出できるようになる。

【0020】この(イ)と(ロ)に基づく効果により、 磁気ヘッドの浮上量を著しく小さく設定することが可能 となり、しかも磁気ヘッド浮上量をほぼ一定に保持する ことができるようになる。

【0021】なお、本明細書において、磁気ディスクと 磁気記録媒体とは、同一である。

【0022】発明者らは磁気記録媒体に形成する種々の 凹凸形状について検討を行った結果、長期にわたる磁気 ヘッドの浮上安定性を確保するためには、基板上に磁性 層及び表面保護層を形成し、表面保護層の表面に凹凸形 状を与えるに際し、その凹凸の配置が破気ヘッド又は破 気記録媒体に付着した微小塵埃を速やかに除去しうるよ うな作用を有することが極めて重要であることを見出し た。

【0023】従来技術の特開平1-134720号公報、特開 平1-122028号公報及び特開昭57-20925号公報のいず れにも、磁気記録媒体表面の凹凸によって塵埃除去作用 を持たせることは記載されていない。又、塵埃除去作用 を有するような凹凸形状或いは凹凸配置になっていな 11

【0024】本発明において、磁気記録媒体表面の凸部 は、表面平坦であることが望ましく、特に全ての凸部が ほぼ一定の高さに保たれていることが望ましい。

な凸部表面に部分的に鋭い突起があると、磁気ヘッドの 浮上安定性が悪くなり、最悪の場合には磁気ヘッドと磁 気記録媒体が接触することにより磁気記録媒体又は磁気 ヘッドの破損を引き起こす恐れがある。

【0026】更に凹凸形状の不均一は、磁気ヘッドの浮 上安定性に影響し、たとえ磁気へッドと磁気記録媒体と が接触しなくとも、浮上量が変化しやすくなるという問 題点がある。したがって、凸部は規則的に或いはほぼ規 則的に配置されていることが、望ましい。

【0027】磁気ヘッドの浮上量の変動は、記録再生時 の出力変動を引き起こし、S/N比低下の一因となる。 さらに浮上量の変動によっては、磁気ヘッドの位置決め のためのサーボ信号の出力も変動するため、磁気ヘッド の位置決めの精度が低下するという問題点もある。この ような磁気ヘッドの浮上量変動による問題点は、磁気デ ィスク装置の高記録密度化のために浮上量を小さくする ほど、例えば浮上量を0.2μm以下とした場合に特に 顕著になる。

【0028】凸部表面が平坦であることの目安として、 触針式粗さ計で磁気ディスク表面の円周方向の任意長さ 20 例えば100 μmの長さの凸部高さ(凸部上面の中心線 から隣接する凹部の中心線までの高さ)を測定したとき に、最大凸部高さの30%を超える高さの突出部を凸部 表面に有しないことが望ましい。

【0029】又、凸部高さがほぼ一定であることを目安 として、触針式粗さ計で任意長さ例えば100µmの凸 部高さを測定したときに、最大凸部高さの50%以上の 高さの凸部について、その高さの平均値に対して30% を超える高さ或いは30%を下回る高さの凸部が存在し 30 ないことが望ましい。

【0030】磁気ディスクすなわち磁気記録媒体の最も 近接している凸部間の間隔はO.2~50μmであるこ とが望ましい。

【0031】凸部の個数は400個/mm2以上であ り、250,000個/mm2を超えないことが望ましい。

【0032】凸部がまばらに存在すると空気流の乱れが 生じやすくなり、磁気ヘッドの浮上量変動が起こりやす い。一方、凸部が密に存在しすぎると塵埃が排出されに くくなる。

【0033】凸部一個当りの大きさは、磁気ディスクの 半径方向の幅で0.1 μm以上、10 μm以下、磁気デ ィスクの円周方向の幅で0.5μm以上、1mm以下で あることが望ましい。

【0034】半径方向の幅で0.1µmよりも小さいと 塵埃が凸部に衝突したときに、凸部が強度的に持たず破 損したりするおそれがある。半径方向の凸部の幅が10 μmよりも大きいと、塵埃が凸部の左右両側に移動しに くくなり、塵埃をかみ込んでしまうおそれがある。

【0035】円周方向の凸部の幅が0.5μmよりも小 【0025】凸部表面が鋭くとがっていたり或いは平坦 50 さいと塵埃が衝突したときに強度的に弱く、1mmより

20

も大きいと塵埃が磁気ディスクの半径方向へ排出されに くくなるおそれである。

【0036】凸部の高さは5 nmよりも高く、40 nm よりも低く、その範囲内でほぼ一定の高さを有すること が望ましい。

【0037】更に、凸部は磁気ディスク表面の凸部形成 領域内において、一平方ミリメートル当りの凸部総面積 の面積比率が0.1%以上、80%以下になるように備 えられていることが望ましい。

【0038】凸部は、磁気ディスク表面に同一円周上で 10 の前記凸部の面積比率の偏差が一平方ミリメートル当り 20%以内になるように規則的に或いはほぼ規則的に配 置されていることが望ましい。

【0039】凸部の分布が著しくばらつくと、磁気ヘッ ドの浮上量の変動をきたすおそれがある。

【0040】塵埃を磁気ディスク表面の凸部間の凹みを 利用して磁気ディスクの外部へ排出しやすくするため に、凹部の底面もできるだけ平坦面とすることが望まし 11

【0041】凹部底面が平坦面であることの目安とし て、触針式粗さ計で測定した任意長さ、例えば100μ mの長さにおける最大凸部高さの30%を超える高さの 凸部を凹み部に有しないことが望ましい。

【0042】更に、塵埃を磁気ディスクの外周に向けて 排出しやすくするために、磁気ディスクを回転したとき に磁気ヘッドに対し凸部を順次外周側にずれて位置する ように配置することが望ましい。

【0043】本発明によれば、磁気ディスクと磁気ヘッ ドとの間隔を0.02~0.2μmという今までに例の ない微小間隔に設定し、なお且つ浮上量を安定に維持す 30 ることができる。

【0044】磁気ディスク表面の凸部は、例えば下記 ①、②及び③の方法によって形成することができる。

【0045】 の基板表面に直接又は下地層を有する基板 表面に凸部を形成、②磁性層表面に凸部を形成、③保護 層表面に凸部を形成。

【0046】磁気ヘッドの浮上量を0.02~0.2 μ mと著しく小さくする場合には、磁性層表面に凹凸があ ると、それがS/N比の低下に影響しやすい。従って、 磁気ヘッドの浮上量をこのように著しく小さくする場合 には、磁性層を平坦面とし、その上の表面保護層に凸部 を形成することが望ましい。

【0047】ただし、前記 および のように基板表面 あるいは磁性層表面に凸部を形成した場合でも、形成し た凸部の形状が磁気ディスク表面まで実質的に維持され ている場合には、浮上量の安定維持に対しては十分に効 果がある。

【0048】一般の磁気記録媒体の基板はアルミニウム 合金円板と、その上に形成された硬質な下地層より成

硬度の高い円板材料を用いた場合には下地層が省略され ることもある。本発明ではこれらを含めて基板と総称す る。基板の上には磁性層が形成されるが、この両者の間 には、密着性向上や磁性層の特性向上を目的として中間 層が形成される場合もある。磁性層の上には保護層さら には必要に応じて潤滑層が形成されて、磁気記録媒体が 構成される。

【0049】本発明では、保護層と潤滑層とを含めて表 面保護層と総称する。

【0050】保護層は、一層だけに限らず、多層に形成 してもよい。

【0051】磁気記録媒体の製造方法としては、下記 (イ)~(二)の方法が好ましい。

【0052】(イ) 表面保護層として潤滑層およびその 下層の保護層を備えた磁気記録媒体の製造方法におい て、前記保護層表面にマスクパターンを形成し、該保護 層をその膜厚の範囲内で該マスクパターンに従ってエッ チングしたのち、該マスクパターンを除去することによ り、所望の形状、寸法の凸部を形成し、その後その上に 前記潤滑層を形成する。

【0053】(ロ) 表面保護層として潤滑層およびその 下層の保護層を備えた磁気記録媒体の製造方法におい て、前記保護層表面にリングラフィー技術によりマスク パターンを形成し、該保護層をその膜厚の範囲内で該マ スクパターンに従ってエッチングしたのち、該マスクパ・ ターンを除去することにより、所望の寸法、形状の凸部 を形成し、その後その上に前記潤滑層を形成する。

【0054】(ハ) 表面保護層として潤滑層およびその 下層の保護層を備えた磁気記録媒体の製造方法におい て、前記保護層表面に光、レーザ、又は荷電粒子のビー ム照射により硬化しうる物質を 状に形成し、該 面に 光、レーザ、又は荷電粒子のビームを選択的に照射して 部分的に硬化させたのち未硬化部を除去することによ り、所望の寸法、形状の凸部を形成し、その後その上に 前記潤滑層を形成する。

【0055】(二) 表面保護層として潤滑層と二層の保 護層を形成し磁気記録媒体を製造する方法において、前 記二層の保護層を形成したのち表面にマスクパターンを 形成し、上層に当たる第二層目の該保護層を該マスクパ ターンに従ってエッチングしたのち、該マスクパターン を除去することにより、第一層目の保護層の表面に所望 の寸法、形状の凸部を形成し、その後潤滑層を形成す

【0056】磁気記録媒体の表面に凹凸を形成した従来 技術としては、先に示した3件の公開特許公報のほかに 下記がある。

【0057】特開昭55-84045号公報:鏡面基板上に表 面粗さ20~50 nmの保護層を形成する。

【0058】特開昭58-53026号公報:保護層表面に気 る。アルミニウム合金の代りにガラス、セラミックス等 50 体イオンを照射して面粗度50~100n までエッチ ングする。

【0059】特開昭62-22241号公報:保護層にその膜 厚を超えない範囲の凹凸を形成する。 特開昭62-2314 27号公報:保護用表面に同心円状の溝を形成する。

【0060】特開昭62-222435号公報:金属アルコキシ ドの硬化膜保護層にレーザを部分照射して凹凸を形成す

【0061】特開昭63-188821号公報:保護層状にシリ コンオイル膜を形成し、部分的にエキシマレーザーで硬 化してスパイラル状、同心円状或いはスポット状の凹凸 10 を形成する。

【0062】特開平1-13227号公報:潤滑層の厚さよ りも大きく保護層の厚さよりも小さい同心円状の保護層 を形成する。

【0063】特開昭62-107427号公報: 炭素を主とする 潤滑膜(保護層)を研磨により粗面化する。

【0064】特開昭63-191312号公報:保護層表面を円 周方向に研磨し、凹凸を形成する。

【0065】特開昭61-120344号公報:磁気ヘッドより も硬い物質を含む保護層を形成後、一部をスパツタエッ チングして微小突起を形成する。

【0066】特開昭63-29320号公報: 磁性層上に島状 に硬い物質を固定する。

【0067】特開昭61-216114号公報:有酸化合物のプ ラズマ重合保護層に凹凸を形成する。 特開昭62-2442 3号公報:保護層にその膜厚を超えない範囲で凹凸を形 成する。 特開昭63-168830号公報: 二層構造の保護層 表面をプラズマエッチングして凹凸を形成する。

【0068】特開平1-109527号公報:磁気記録媒体表 面の低硬度保護層にスタンプで凹凸を形成する。

【0069】これらの技術は、いずれも磁気ヘッド支持 用スライダーに付着した塵埃を磁気ディスクの外部へ排 出するように凹凸を形成することは開示していないし、 又、そのような機能を有していない。

【0070】本発明によれば、第一に、表面保護層の表 面に凸部を備えることにより、凸部分のみが磁気ヘッド と直接対向し、磁気記録媒体の磁気ヘッドと接触する面 積比率を小さくできるため、磁気ヘッドとの摩擦力や吸 着力を低くすることができる。第二に、表面保護層に形 成される凸部を規則的或いはほぼ規則的に配置すること により、磁気ヘッドの浮上量変動が少なく、磁気記録媒 体の全面に有って磁気ヘッドの浮上安定性を確保でき、 浮上量変動による出力変動を防止できる。第三に、平坦 に加工された基板上に磁性層を形成した場合には、磁性 層もほぼ平坦となり、磁性層の凹凸による記録再生時の 出力変動を小さくすることができる。

【0071】以上のように本発明によれば、磁気ヘッド との摩擦力や吸着力を低くし、出力変動を防止し、磁気 ヘッドの安定浮上を確保できるため、高い記録再生精度

8 化に対応できる磁気記録媒体及びそれを用いた磁気ディ スク装置を得ることができる。

【0072】さらに第四に、表面保護層に備えられる凸 部を、磁気ヘッド又は磁気記録媒体に付着した微小塵埃 を速やかに除去しうるように配置することにより、微小 塵埃による磁気ヘッドクラッシュを起こりにくくし、長 期にわたって磁気ヘッドの浮上安定性を確保することが できる。

【0073】以上のように本発明によれば、長期にわた る磁気ヘッドの安定浮上を確保できるため、高い記録再 生精度を有し、また高記録密度化に伴う磁気ヘッドの低 浮上量化に対応でき、かつ長期の耐久性を有する磁気記 録媒体及びそれを用いた磁気ディスク装置を得ることが できる。

[0074]

20

40 V)

【発明の実施の形態】以下本発明を、具体的に説明す る。

【0075】表面保護層表面に備えられる凸部は、特許 請求の範囲に記載の(イ)、(ロ)の要件を具備し、且 つ規則的に配置されていることが望ましい。これによ り、磁気記録媒体の全面において磁気ヘッドの浮上量を 安定に制御でき、浮上量変動による出力変動を押さえる ことができる。特に、少なくとも磁気記録媒体の回転中 心に対する同一円周上の任意の点では、単位面積当た り、例えば一平方ミリメートル当たりの凸部の面積比率 がほぼ一定となるようにすれば、磁気ヘッドをあるトラ ック位置に静止して磁気記録媒体を回転された場合に、 磁気ヘッドはスライダーの大きさの範囲内で常にほぼ同 一の面積比率で凸部に対することになり、浮上量変動を 30 低く抑えることができる。また、凸形成部の全面にわた り、単位面積当たり、例えば一平方ミリメートル当たり の凸部の面積比率がほぼ一定となるようにすれば、磁気 記録媒体を回転させて磁気ヘッドを移動させた場合で も、磁気ヘッドはスライダーの大きさの範囲内で常にほ ぼ同一の面積比率で凸部に対することになり、全面に亘 って浮上量変動を低く抑えることができる。ただし、磁 気記録媒体の回転によっては、内周部と外周部では線速 度が異なるため、必要に応じて内周側から外周側にかけ て凸部の面積比率を連続的に少しずつ変化させてもよ

【0076】表面保護層表面に備えられる凸部は、少な くとも磁気記録媒体の同一円周上で不連続とする。これ は、磁気ヘッドを静止して磁気記録媒体を回転させた場 合、磁気ヘッドのある一点からみると断続的に凸部に対 することになり、これにより磁気ヘッドに微小塵埃が付 着した場合でも容易に除去されるためである。

【0077】また表面保護層表面に備えられる凸部は、 不連続な線状またはビット状であって、凸のない部分の 少なくとも一部が磁気ヘッドの移動領域内において、磁 を有し、また高記録密度化に伴う磁気ヘッドの低浮上量 50 気記録媒体の内周から外周にかけてなめらかに連続して

いることが望ましい。これは、磁気ヘッドと磁気記録媒体の間に微小塵埃が侵入した場合でも、凸未形成部に沿って遠心力により微小塵埃が外周側に除去されやすいためである。

9

【0078】上記のような条件を全て満足する。最も好 適な凸部の配置は以下のようなものである。例えば、磁 気記録媒体の回転中心又は回転中心から意図的にずらし たパターン中心に対して同心円又はらせん状の円弧の一 部よりなる線状またはビット状の凸部を全面に亘って規 則的に配置したものであって、凸部のない部分の少なく とも一部が磁気ヘッドの移動領域内において、磁気記録 媒体の内周から外周にかけてなめらかに連続するように 凸部が配置されている。より具体的に例を述べれば、例 えば幅2μm、ピッチ6μmで磁気記録媒体の回転中心 に対して同心円状の円弧上に、例えば中心角で0.02 度分の円弧状の凸部を中心角で0.03度おきに磁気デ ィスクの回転方向に向かって順次内周側に2µmずつず らして全面に形成したものである。ここに示した凸部の 配置パターンの例を模式的に第4図に示す。この具体例 では、磁気ディスク上にスライダーを置いて磁気ディス クを回転させた場合、凸部が順次外周側にずれながらス ライダー全面に対するため、スライダーに付着した塵埃 を除去する効果が大きい。また凸部7の切り裂き部分が 磁気記録媒体(磁気ディスク)14の内周から外周にか けて直線的に連続するため、磁気ヘッドと磁気記録媒体 の間に微小塵埃が侵入した場合でも、遠心力により微小 塵埃が外周側に除去されやすい。なお、実際には第4図 のような円弧状の凸部が全面に多数配置された形状をと る。磁気ディスクの半径50mmの位置における、実縮 尺での本具体例の凸部配置を200μm四方の面積につ 30 いて示したものが第9図である。

【0079】この例では、一平方ミリメートル当りの凸部の面積比率は磁気ディスク全面に亘って約22%であり、一平方ミリメートル当りの凸部の個数は、半径50mmの位置で約6,500個である。

【0080】本具体例の変形例としては凸部の大きさや ピッチを変えた第5図の配置や、凸部の配置をななめに ずらした第10図のような例がある。

【0081】また他の例としては、規則的な格子模様の 頂点に対応する部分にビット状の凸部を全面に亘って規 40 則的に配置したものが好適である。より具体的に例を述 べれば、例えば4μmピッチの四角格子の交点に対応す る部分に、例えば直径2μのビット状の凸部を全面に配 置したものである。ここで示した凸部の配置パターンの 例を模式的に第6図に示す。なお、実際には第6図のよ うなビット状の凸部7が全面に多数配置された形状をと る。ここで用いられる格子模様としては、上記したよう な四角格子の他に三角格子、六角格子等規則的に描かれ るものであれば良い。このように凸部を配置した場合に は、スライダーを静止して磁気記録媒体を回転させた場 50

合、凸部が断続的にスライダー全面に対するため、スライダーに付着した微小塵埃を除去する効果が大きい。またこの例の場合には、凸部間のすきまは、磁気記録媒体の内周から外周にかけて直線的に連続するため、磁気へッドと磁気記録媒体の間に微小塵埃が侵入した場合でも、遠心力により微小塵埃が外周側に除去されやすい。この例では、一平方ミリメートル当りの凸部の面積比率は磁気ディスク全面に亘って約20%であり、一平方ミリメートル当りの凸部の個数は磁気ディスク全面に亘って62.500個である。

【0082】なお、上記以外でも、磁気ヘッドに付着した微小塵埃を除去する作用及び磁気記録媒体と磁気ヘッドの間に介在する微小塵埃を磁気記録媒体の外周方向に排除する作用を有するように配置された凸部であれば、他の配置でもかまわない。

【0083】表面保護層表面に具備される凸部の高さは、5nm以上、40nm以下の範囲でほぼ一定であることが望ましい。凸部の高さが5nmよりも低くなると磁気ヘッドと磁気記録媒体の摩擦力及び吸着力低減の効果が小さくなってくる。凸部の高さが40nmよりも高くなると記録再生時に磁気ヘッドと凸部間の凹部の磁性層との距離が大きくなるため出力が低下し、また磁気ヘッドの浮上安定性が損なわれてくる。また、凸部の高さが不均一であると高い部分が突起となるため浮上安定性に対して好ましくない。

【0084】表面保護層表面に具備される凸部の半径方向での幅は0.1 μm以上、10 μm以下、好ましくは0.3 μm以上、3 μm以下が望ましい。凸部の幅が0.3 μmよりも小さくなると凸部形成時の精度が得られにくくなるおそれがある。凸部の幅が3 μmよりもおおきくなると、磁気ヘッドと磁気記録媒体の摩擦力及び吸着力低減の効果が小さくなってくるおそれがある。

【0085】表面保護層表面に具備される凸部の面積比率は、0.1%以上、80%以下、好ましくは0.5%以上、70%以下が望ましい。凸部の面積比率が0.5%よりも小さいと、僅かな面積で磁気ヘッドを支えることになるため凸部の部分が摩耗しやすく、長期にわたる振動耐久性が低下する。また凸部の面積比率が小さくなるとヘッドの浮上安定性が損なわれる恐れがある。凸部の面積比率が70%よりも大になると、磁気ヘッドと磁気記録媒体の摩擦力及び吸着力低減の効果が小さくなってくる。

【0086】表面保護層の凸部が形成される範囲は、磁気記録媒体の全面としてもよいが、磁気記録媒体が組み込まれる磁気ディスク装置の仕様により、コンタクト・スタート・ストップ (CSS)ゾーンが専用に設けられる場合には、その部分のみに形成してもよい。その理由は、これまで述べてきたように磁気ヘッドとの摩擦力や吸着力、微小塵埃の影響等は、主に磁気ディスク装置の起動、停止時に問題となるもので、磁気ヘッドが安定に

浮上している状態では凸部を形成する効果が比較的少な いためである。

【0087】保護層の材料は、耐摩耗性の観点から硬度の高いものが望ましい。このような材料としては、例えばA1,Si,Ti,V,Cr,Zr,Nb,Mo,Hf,Ta,W等の金属の酸化物、窒化物、炭化物、及びC,BN等を単独又は二種以上複合にしたものが望ましい。また磁気ディスク装置としてみた場合には、磁気記録媒体の保護層材料の硬度は、組み合わされる磁気へッドのスライダー材料の硬度に比べて同等以上であること 10が望ましい。これは、摺動によって摩耗が発生した場合、保護層が摩耗すると磁気記録媒体の特性劣化を起こしやすいが、スライダー側の微小な摩耗は磁気へッドの特性には比較的影響しにくいためである。そのような組み合せの具体例としては、例えば上記の保護層材料とMn-Znフェライトスライダーの組み合わせ等が考えられる。

【0088】本発明による磁気記録媒体を形成する具体 的な方法は以下の通りである。鏡面加工された非磁性円 板状の基板に磁性層及び保護層を形成する。基板と磁性 20 層のあいだには中間層を形成する場合もある。保護層の 表面に凸部を形成する方法としては、保護層表面に所望 のマスクパターンを例えばリゾグラフィー技術により形 成した後、エッチングを行ない、マスクパターンで覆わ れなかった部分のみを選択的に均一エッチングして保護 層の膜厚以下で一定深さまで除いた後、マスクパターン を除去する方法が好ましい。ここで用いられるエッチン グ方法は、イオンミリングや反応性プラズマ処理等のド ライエッチングや湿式のエッチング等の中から保護層の 材料に応じて選択される。また、ここで用いられる保護 30 層は、均一な一層構造として上層のみがエッチングされ る条件で上記のパターン形成を行えば、一定膜厚の下層 保護層上に一定高さの上層保護層材料よりなる凸部を形 成することができる。

【0089】凸部を形成する他の方法としては、保護層の表面に光、レーザ又は荷電粒子のビーム照射により硬化しうる物質を膜状に形成し、この膜面に光、レーザ又は荷電粒子のビームを所望の位置に規則的に照射して部分的に硬化させた後、未硬化部を除去することによっても同様に形成できる。

【0090】なお、上記方法以外でも、最終的に得られる凸部の形状が所望のものであれば、他の方法を用いても構わない。例えば、鏡面加工された非磁性円板上に磁性層及び保護層を形成した円板上に、光分解性の有機金属ガスを導入して、レーザビームを円板上に周期的且つ規則的に照射して、選択的に金属を折出させる方法(レーザCVD法)等によっても同様な形状の凸部を形成することができる。

【0091】上記のように表面に凸部を形成した保護層の上には、必要に応じて潤滑層が形成されて磁気記録媒 50

体となる。

【0092】なお、上記製造方法では、保護層の表面に 凸部を形成する方法を示したが、同様な方法によって例 えば鏡面加工された基板上に凸部を形成した後、中間 層、磁性層、保護層および潤滑層を各々一定厚さで形成 すれば、基板上に形成した凸部形状は磁気ディスク表面 まで実質的に維持されるため、同様な表面形状を有する 磁気記録媒体を得ることができる。

12

【0093】第8図は、本発明の一実施例による磁気ディスク装置の構成を示す概略図である。

【0094】磁気ディスク装置は、第8図に示す符号1 1~18の構成要素及びボイスコイルモータ制御回路を 含む

【0095】符号11はベース、符号12はスピンドル である。

【0096】一つのスピンドルに図のように複数枚の円板状の磁気ディスク14が取り付けられる。

【0097】第8図では、1つのスピンドルに五枚の磁 気ディスク14を設けた例が示されているが、五枚に限っ 3 るものではない。

【0098】また、このように一つのスピンドル12に 複数枚の磁気ディスク14を設けたものを複数個設置し てもよい

【0099】符号13はスピンドル12を駆動し、磁気 ディスクを回転するためのモータすなわち磁気ディスク 回転制御手段である。

【0100】符号15はデータ用磁気ヘッドを示し、符号15aは位置決め用磁気ヘッドを示している。

【0101】符号16はキャリッジ、符号17はボイスコイル、符号18はマグネットである。

【0102】ボイスコイル17とマグネット18によりボイスコイルモータが構成される。

【0103】そして符号16、符号17、符号18の要素によりヘッドの位置決めがなされる。従って符号16、17、18を含めて磁気ヘッド位置決め機構と総称する

【0104】ボイスコイル17と磁気ヘッド15及び1 5aとは、ボイスコイルモータ制御回路を介して接続さ カアいる

【0105】第8図において、上位装置とは例えばコンピュータシステムを示し、磁気ディスク装置に記録された情報を処理する機能を有するものである。その記録再生方法は、操作開始前には磁気ヘッドと磁気記録媒体が接触状態であるが、磁気記録媒体を回転させることにより磁気ヘッドと磁気記録媒体の間に空間を作り、この状態で記録再生を行なう。操作終了時には磁気記録媒体の回転が止まり、磁気ヘッドと磁気記録媒体は再び接触状態となる。これをコンタクト・スタート・ストップ方式、以下CSS方式と称する。

50 【0106】第9図と第10図および第11図は、磁気

る.

記録媒体表面の平面図であり、凸部の配置の例を示して いる。第9図および第10図は本発明であり、第11図 は比較例である。

【0107】正方形の枠は磁気記録媒体表面の200μ m四方の範囲を示している。

【0108】第11図の比較例は、円周方向に連続した 凸部を形成した例を示している。

【0109】以下より具体的な実施例により、本発明を さらに詳細に説明する。

【0110】〔実施例1〕外径5.25インチのアルミ 10 ニウムに合金円板の表面に無電解めっき法によりNi-P下地膜を15μm厚さに形成し、下地膜を10μmま で研磨して、触針式表面粗さ計で測定した平均粗さ(R a) 3 nm以下、最大粗さ (Pmax) 7 nm以下にな るように鏡面加工した。

【0111】こうして得られた基板上に、スパッタ法に よりCr中間層を0.2 μm厚さ、Co-Ni磁性層を 40nm厚さ、C保護層を20nm厚さに形成した。C 保護層の表面にポジ型レジスト (東京応化、OFPR800) を約0.5µm厚さに塗布し、第4図に示した形状で凸 20 部分のみ光が透過しないように形成したフォトマスクを 密着させて露光した後現像し、C保護層の表面に、図4 に示した形状で凸部分のみレジストが残っているマスク パターンを形成した。

【0112】この円板を、イオンミリング装置を用いて アルゴンイオンビームを30秒間全面に照射して、マス クパターンを形成していない部分を均一にエッチングし た後、レジスト除去液によりマスクパターンを除去し て、保護層表面に規則的に配置された凸部を形成した。 【0113】こうして得られた円板の表面に、潤滑層と してパーフルオロポリエーテル系の潤滑剤を約5 n m厚 さに塗布して磁気記録媒体を作製した。形成した凸部の 高さを、磁気記録媒体表面の任意の10点で、走査型ト ンネル顕微鏡 (Scanning Tu-nneling Microscope, ST M) 及び触計式表面粗さ計により測定した結果、いずれ の測定点でも凸部の高さは10 nmであった。オージエ 電子分光法により得られた磁気記録媒体の表面を測定し たところ、Co及びNiは検出されず、磁性層の露出部 分のないことを確認した。凸部の大きさ及び凸部間の間 隔は、図4に示すとおりである。

【0114】本実施例の磁気記録媒体の、半径方向での 断面構造の模式図を図1に示す。図1において、符号1 はアルミニウム合金円板、2は下地層、3は巾間層、4 は磁性層、5は保護層、6は潤滑層を示す。円板1と下 地層2によって基板が構成される。 なお本実施例では、 凸部の面積比率は全面にわたり約22%である。

【0115】〔実施例2〕フォトマスクとして図5に示 した形状で凸部のみ光が透過しないように形成した物を 用い、C保護層の厚さを30nmとし、凸部を形成する

たほかは、実施例1と同様な方法で磁気記録媒体を作製 した。走査型トンネル顕微鏡及び触針式表面粗さ計によ り磁気記録媒体表面の任意の10点で凸部の高さを測定 した結果、いずれの測定点でも凸部の高さは20 nmで あった。凸部の大きさ及び凸部間の間隔は図5に示すと おりである。図7に本実施例による磁気記録媒体表面の 凸形成部を、半径方向で触針式表面粗さ計により測定し

た結果の一例を示す。なお本実施例では、凸部の面積比

率は全面にわたり約19%である。

14

【0116】 〔実施例3〕 フォトマスクとして、図6に 示した形状で凸部のみが光が透過しないように形成した 物を用いた他は実施例1と同様な方法で磁気記録媒体を 作製した。STM及び触針計式表面粗さ計により磁気記 録媒体表面の任意の10点で丘の高さを測定した結果、 いずれの測定点でも、凸部の高さは10 nmであった。 凸部の大きさ及び凸部間の間隔は図6に示すとおりであ

【0117】本実施例の磁気記録媒体の、半径方向での 断面構造の模式図を図2に示す。なお本実施例では、凸 部の面積比率は全面にわたり約20%である。

【0118】 〔実施例4〕 保護層としてSiCをスパッ 夕法で20mm厚さに形成し、凸部を形成するためのイ オンミリングによるエッチング時間を20秒としたほか は、実施例1と同様な方法で磁気記録媒体を作製した。 触針式表面粗さ計により磁気記録媒体表面の任意の10 点で凸部の高さを測定した結果、いずれの測定点でも凸 部の高さは10nmであった。

【0119】 〔実施例5〕 保護層として、メタンー水素 混合ガスを原料としたプラズマCVD法で20nm厚さ は形成したC膜(いわゆるi-C)を用い、凸部を形成 するためのイオンミリングによるエッチング時間を1分 としたほかは、実施例1と同様な方法で磁気記録媒体を 作製した。触針式表面粗さ計により磁気記録媒体表面の 任意の10点で凸部の高さを測定した結果、いずれの測 定点でも凸部の高さは10 nmであった。

【0120】〔実施例6〕実施例1と同様に基板1上に Ni-P下地層2を形成し、この上にスパッタ法により Cr中間層3を0.2μm厚さ、Co-Ni磁気層4を 40nm厚さ、第一保護層5aとしてSiCを10nm 40 厚さ、第二保護層5bとしてCを10nm厚さに形成し た。C第二保護層5bの表面に実施例1と同様の方法で マスクパターンを形成し、酸素アッシャー装置を用いて 酸素プラズマに1分間さらした後、レジスト除去液によ りマスクパターンを除去した。得られた円板表面を分析 したところ、マスクパターンのなかった部分では、Cは 酸素プラズマのエッチングにより消失してSiCが露出 し、マスクパターンの部分のみにCが凸状に残存し凸部 7が形成されていることがわかった。触針式表面粗さ計 により円板表面の任意の10点で凸部7の高さを測定し ためのイオンミリングによるエッチング時間を1分とし 50 た結果、いずれの測定点でも凸部7の高さは10nmで

あったことから、酸素プラズマによってSiCはほとん どエッチングされていないことがわかる。つまり、凸部 7は第二保護層5bに形成される。また、第一保護層5 aとして用いたSiCは耐食性を有するものである。

【0121】こうして得られた円板の表面に、潤滑層6 としてパーフルオロボリエーテル系の潤滑剤を約5 nm 厚さに塗布して磁気記録媒体14を作製した。

【0122】 (実施例7) 実施例1と同様の基板上に、 スパッタ法によりCr中間層を0.2μm厚さ、Co-Ni磁性層を40nm厚さ、保護層としてSiCを10 10 nm厚さに形成した。SiC保護層の表面に、テトラヒ ドロキシシランの溶液を約15 nm厚さにスピン塗布し た後、スポット径2µmに集光したArレーザを、図4 に示したパターンで凸部分のみに選択的に照射して、照 射部のテトラヒドロキシシランをSiO2に変化させて 硬化した後、未硬化部のテトラヒドロキシシランを洗浄 除去して、図4に示すように保護層表面に規則的に配置 された凸部を形成した。

【0123】こうして得られた円板の表面に、潤滑層と してパーフルオロボリエーテル系の潤滑剤を約5 n m塗 20 布して磁気記録媒体を作製した。形成した凸部の高さ を、磁気記録媒体表面の任意の10点で、触針式表面粗 さ計により測定した結果、いずれの測定点でも凸部の高 さは10nmであった。

【0124】なお本実施例では、凸部の面積比率は全面 にわたり約22%である。

【0125】〔実施例8〕基板として、触針式表面粗さ 計で測定した平均粗さ(Ra)2nm以下、最大粗さ (Rmax) 5 nm以下になるように鏡面加工した外径 5. 25インチの強化ガラス円板を用いたほかは、実施 30 例1と同様な方法で磁気記録媒体を作製した。触針式表 面粗さ計により磁気記録媒体表面の任意の10点で凸部 の高さを測定した結果、いずれの測定点でも凸部の高さ は10nmであった。

【0126】 [実施例9] 実施例1と同様の基板上に、 直接実施例1と同様の方法でマスクパターンを形成し、 イオンミリング装置によりアルゴンイオンビームを10 科間全面に照射した後マスクパターンを除去して、基板 表面に規則的に配置された凸部を形成した。触針式表面 粗さ計により基板表面の任意の10点で凸部の高さを測 定した結果、いずれの測定点でも凸部の高さは10 nm であった。

【0127】この基板上に実施例1と同様な方法で中間 層、磁性層、保護層をスパッタ法で形成し、保護層の上 にそのまま潤滑層としてパーフルオロボリエーテル系の 潤滑剤を約5 n m 厚さに塗布して磁気記録媒体を作製し た。触針式表面粗さ計により磁気記録媒体表面の任意の 10点で凸部の高さを測定した結果、いずれの測定点で も凸部の高さは10nmであり、基板上に形成した凸部 形状が磁気記録媒体表面まで実質的に維持されているこ 50 状の凸部が全面に形成されていることを確認した。ST

とを確認した。

【0128】本実施例の磁気記録媒体の、半径方向での 断面構造の模式図を図3に示す。

16

【0129】 〔比較例1〕実施例1と同様の基板上に、 実施例1と同様な方法で中間層、磁気性、保護層をスパ ッタ法で形成し、保護層の上にそのまま潤滑層としてパ ーフルオロポリエーテル系の潤滑剤を約5 n m厚さに塗 布して磁気記録媒体を作製した。凸部は形成しなかっ た。

【0130】 〔比較例2〕 実施例1と同様の基板を回転 させながら、研磨砥粒を含ませたバフを押しつけて研磨 し、ほぼ円周方向に沿った連続溝を形成した。こうして 得られた基板表面は、触針式表面粗さ計で測定して平均 粗さ(Ra)10nm、最大粗さ(Rmax)35nm であった。

【0131】この基板上に、実施例1と同様な方法で中 間層,磁性層,保護層をスパッタ法で形成し、保護層の 上にそのまま潤滑層としてパーフルオロポリエーテル系 の潤滑剤を約5 nm厚さに塗布して磁気記録媒体を作製 した。

【0132】 (比較例3) 実施例1と同様に基板上に、 スパッタ法によりCr中間層を0.2μm厚さ、Co-Ni磁性層を40nm厚さ、保護層としてCを40nm 厚さ形成した。この円板を回転させながら、研磨砥粒を 含ませたバフを押しつけてC保護層を約10nm厚さに 研磨し、ほぼ円周方向に沿った溝を形成した。そして円 板表面に、潤滑層としてパーフルオロボリエーテル系の 潤滑剤を約5 nm厚さに塗布して磁気記録媒体を作製し た。

【0133】こうして得られた磁気記録媒体表面は、触 針式表面粗さ計で測定して平均粗さ(Ra)10nm, 最大粗さ (Rmax) 30 nmであった。

【0134】〔比較例4〕実施例1と同様の基板上に、 スパッタ法によりCr中間層をO.2μm厚さ、Co-Ni磁性層に40nm厚さ、保護層としてCを30nm 厚さに形成した。

【0135】この円板をスパッタ装置中で逆スパッタし てC保護層を約10nm厚さまでエッチッグした。

【0136】得られた円板の表面に、潤滑層としてパー フルオロポリエーテル系の潤滑剤を約5 nm厚さに塗布 して磁気記録媒体を作製した。

【0137】こうして得られた磁気記録媒体表面は、触 針式表面粗さ計で測定して平均粗さ(Ra)8nm、最 大粗さ (Rmax) 15 nmであった。

【0138】 (比較例5) フォトマスクとして、幅2 µ m、ピッチ10μmの同心円状の部分で光が透過しない ように形成した物を用いた他は実施例1と同様な方法で 磁気記録媒体を作製した。磁気記録媒体表面を電子顕微 鏡により観察して、幅2μm、ピッチ10μmの同心円 る。

M及び触針式表面粗さ計により磁気記録媒体表面の任意 の10点で凸部の高さを測定した結果、いずれの測定 点でも、凸部の高さは10nmであった。本比較例の凸 部の配置は図11に示すとおりである。

【0139】なお本実施例では、凸部の面積比率は全面にわたり20%である。

【0140】以上の実施例及び比較例により得られた磁気記録媒体について、Mn-Znフェライト磁気ヘッドを用いて図8に示す磁気ディスク装置を構成し、CSS試験30,000回前後でCSS領域内での 外観検査、 磁気ヘッドとの吸着力、摩擦力の測定、 磁気ヘッドの最低浮上保証高さの測定、 記録再生試験を行った。なお定常回転時の磁気ヘッドの浮上量は、0.1μmで行った。試験結果を図12に示す。

【0141】図12に示すように、凹凸を形成していない比較例1では初期の吸着力、摩擦力が大きく、CSS後の増加も大きい。このためCSS後に表面に線状の摺動痕が発生しており、この損傷により浮上特性試験及び記録再生試験での特性劣化が著しい。

【0142】基板上に研磨法で凹凸を形成した比較例2では、比較例1に比べればCSS後の特性劣化は小さいが依然として特性劣化がかなりあり、初期にも浮上特性が悪く、記録再生試験でエラーが発生している。これは、比較例2においては研磨過程で局部的突起を生成しやすいためと考えられ、この部分がCSS後のビット状の剥離を引き起こしたと考えられる。また比較例2では、基板上に凹凸を形成しているため、上に形成される磁性層も凹凸をもち、初期でもS/N比が低い。

【0143】保護層上に研磨法で凹凸を形成した比較例 3では、比較例2と同様に研磨過程での局部的突起によ 30 ると考えられる浮上特性の不良や、エラーが初期にも発 生している。比較例3では、磁性層はほぼ平坦ため、比 較例2に比べれば初期のS/N比が高いが、それでも不 十分である。これは保護層に形成した凹凸の形状が不均 一であるため、磁気ヘッドの浮上安定性が十分でないた めである。またCSS後の特性劣化も大きく、これは剥 離部等の発生により磁気ヘッドの浮上安定性がさらに損 なわれたためと考えられる。

【0144】保護層上に逆スパッタで凹凸を形成した比較例4では、初期にはエラーがみられないが、浮上特性 40は依然として不十分であり、S/N比もやはり若干低くなっている。これは比較例3と同様に保護層に形成した凹凸の形状が不均一であるため、磁気ヘッドの浮上安定性が十分でないためである。またCSS後の特性劣化がかなりあるが、この原因を解明するためCSS後の剥離部を分析したところ、微小塵埃が食い込んで剥離が発生しいることがわかった。このため、比較例4では磁気ヘッドと磁気記録媒体の間に微小塵埃が介在することによる剥離部の発生により、磁気ヘッドの浮上安定性がさらに損なわれ特性が劣化したものと考えられる。なお比較 50

例2,3の場合もCSS後の剥離部を分析したところ、 同様に微小塵埃が食い込んで剥離が発生している部分が 見出された。

【0145】保護層上に同心円状の観測的な凸部を形成した比較例5では、初期の特性は良好であるが、CSS後の特性劣化が大きい。この原因を解明するためCSS後の剥離部を分析したところ、剥離部周辺に微小塵埃が堆積しており、その一部が食い込んで剥離が発生していることがわかった。このため比較例5では磁気ヘッドの7上安定性が損なわれ特性が劣化したものと考えられ

【0146】これに対し本実施例による磁気記録媒体は、CSS前に良好な特性を示し、CSS後の特性劣化も小さい。これは、本実施例で形成した規則的な凹凸形状が、局部的突起を持たないため、磁気ヘッドの浮上安定性が良好なためである。

【0147】特に、実施例1から実施例8の場合のように、平坦な基板上に中間層、磁性層及び保護層を形成し、保護層の表面にヘッド又は磁気記録媒体に付着した微小塵埃を速やかに除去しうるように規則的に配置された微小凹凸形状を与え、保護層上に潤滑層を形成した場合には、磁気ヘッドとの摩擦力や吸着力が低く、記録再生特性が良好であり、磁気ヘッドの浮上安定性を保証し、長期に亘って特性劣化の小さい磁気記録媒体を得ることができる。

【0148】また実施例9のように基板上に上記作用を有する微小凹凸形状を与え、その上に中間層、磁性層、保護層及び潤滑層を形成した場合でも、磁性層が凹凸をもつことにより実施例1から実施例8に比べてS/N比の若干の低下が見られるものの、凹凸の大きさが小さいため、S/N比の低下量は小さく、またそれ以外の特性は良好である。

【0149】上記した様に本実施例によれば、磁気記録 媒体の表面に磁気ヘッド又は磁気記録媒体に付着した微 小塵埃を速やかに除去しうるように規則的に配置された 微小凹凸形状を与えることにより、磁気ヘッドとの摩擦 力や吸着力が低く、記録再生特性が良好であり、磁気ヘッドの浮上安定性を保証し、長期に亘って特性劣化の小 さい磁気記録媒体を得ることができる。

0 [0150]

【発明の効果】本発明によれば、磁気ヘッドとの摩擦力や吸着力が低く、低浮上量においても磁気ヘッドの浮上安定性を保証し、長期に亘って特性劣化の小さい磁気記録媒体を再現性良く提供することができる。また、磁気記録媒体を構成する保護層を第一保護層と第二保護層に分け、凸部は第二保護層に形成し、この第二保護層の下層に耐食性を有する第一保護層を形成することにより、上記効果に加えて耐食性を有する磁気記録媒体を提供できる。

50 【図面の簡単な説明】

19

【図1】 本発明の一実施例による磁気記録媒体の、半 径方向での断面構造を示す斜視図

【図2】 本発明の一実施例による磁気記録媒体の、半 径方向での断面構造を示す斜視図

【図3】 本発明の一実施例による磁気記録媒体の、半 径方向での断面構造を示す斜視図

【図4】 本発明の一実施例の磁気記録媒体表面に形成 する凸部の配置を示す一部平面図

【図5】 本発明の一実施例の磁気記録媒体表面に形成 する凸部の配置を示す一部平面図

【図6】 本発明の一実施例の磁気記録媒体表面に形成 する凸部の配置を示す一部平面図

【図7】 本発明の一実施例による磁気記録媒体の凸形 成部を、半径方向で触針式表面粗さ 計で測定し結果の 一例を示すグラフ

【図8】 本発明の磁気ディスク装置の一実施例を示す

概略構成図

【図9】 磁気記録媒体表面の凸部の形状、分布の一例 を示す平面図

20

【図10】 磁気記録媒体表面の凸部の形状、分布の一 例を示す平面図

【図11】 磁気記録媒体表面の凸部の形状、分布の一 例を示す平面図

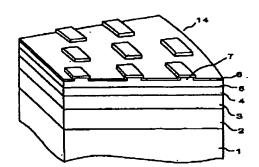
【図12】 本発明の一実施例による磁気記録媒体の、 半径方向での断面構造を示す斜視図。

10 【図13】 CSS試験の結果を表す図 【符号の説明】

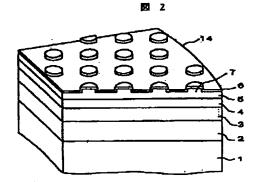
> 1…アルミニウム合金円板、2…下地層、3…中間層、 4…磁性層、5…保護層、5 a…第一保護層、5 b…第 二保護層、6…潤滑層、7…凸部、13…磁気ディスク 回転制御手段、14…磁気記録媒体(磁気ディスク)、 15…磁気ヘッド。

【図1】

図 1

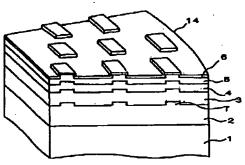


【図2】

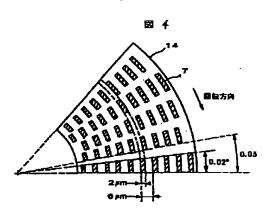


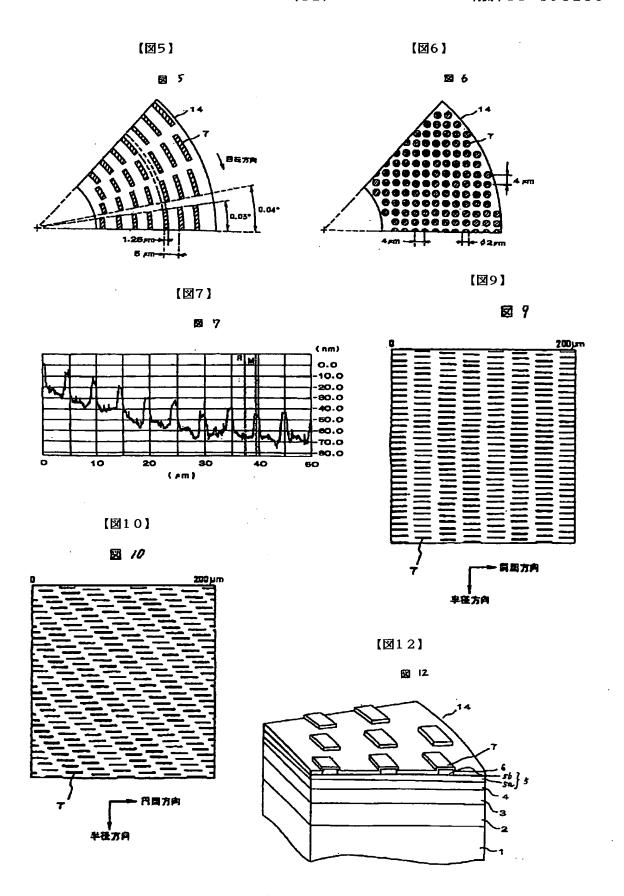
【図3】

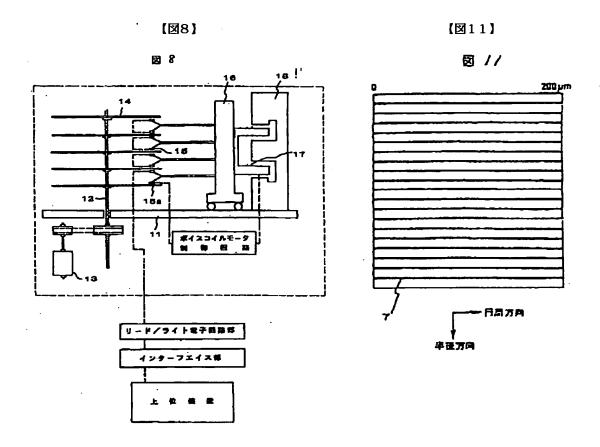
図 3



【図4】







【図13】

国1.3.

系統作はCSS 30.000個後のもの。[] 内はCSS前の割類のもの)

	и	R	Ħ	奁	妖老力	康康力	京 5 京都 京	と、 エラー数	生は異
	1				(gf)	(建築協設)	(pm)	(相/用)	(4B)
突跑例 1	14	1	2	J	5.0 (3.0)	0.33	0.025 [0.020]	(O)	[3 <u>5</u>]
災旋何 2	-	1	ž	Ն	4.5	0.29	0.033	[0]	3 <u>2</u> (3 <u>4</u>)
支統例 3	Œ	1	3	٦	4.8 [2.8]	[0.18]	0.024 [0.020]	(0)	(35)
炎旋例4	55	1	2	L	5.1 [3.1]	(0.19)	[0.013]	(0)	[34]
英雄財 5	4	1	2	b	4.9 [2.9]	0.30	0.025	(0)	1351
汽拖拼 6	Œ	1	3	L	5.2 [3.1]	[0.19]	0.025 (0.011) 0.023	(0)	[25]
天皇例7	Œ	1	2	L	5.1 [2,7]	[0.20]	[0.020]	(0)	(33)
天旋例 5	Œ	1	1	L	4.8 [2.8]	[0.19]	(0.019)	[0]	[36]
汽车 例 9	4	1	2	ı	[2.5]	0.32	0.025		[3]
比較們 L	*	状	7 2	黨	1111	2.0 [0.4]	>0.1 [0.017]	[0]	[3.5]
比較例 2	7	クト	红色	1#	[2.8]	[0.19]	(0.083)	[2]	2 1 [2 6]
比較男 3	۲	ツト	秋	12	(3.0)	[0,20]	[0.070]		[29]
比較例4	7	ツト	铁	1AL	[2,8]	(0.19)	>0.1 [0.040]	[0]	26 [30] 28
比較例5	K.	ツト	以	12	[2,9]	[0.19]	[0.020]	4	[34]

フロントページの続き

(72)発明者 近藤 麻希 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日

立製作所日立研究所内

(72)発明者 大浦 正樹

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会

社日立製作所小田原市工場内

(72)発明者 三宅 芳彦

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会

社日立製作所小田原市工場内

(72)発明者 加藤、義喜

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会

社日立製作所小田原市工場内

(72)発明者 奥脇 東洋治

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 岡本 紀明

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 中川 宣雄

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内